

第15卷第2期 1996年4月

Hg1-*Cd*Te 液相外延薄膜的光致发光

<u>李 标 常 勇</u>V褚君浩 陈新强 曹菊英 唐文国 汤定元 (中国科学院上海技术物理研究所,红外物理国家实验室,上海,200083)

A 摘要 用红外光荧光测量分析了 H_{B1-x}Cd_xTe 液相外延薄膜的发光特性,观察到局域激子及束 缚截子发光.当外延层减薄至 2µm 后,PL 信号的峰位将向离能方向移动,这是由于外延薄膜纵 向组份不均匀引起的.

关键词 光荧光,Hg1-2Cd2Te,液相外延。

Hgcate

TN 30426 TN 213

引言

Hg1--Cd2Te 是研制红外探测器的重要材料,液相外延是一种较为成熟的生长 Hg1-z Cd2Te 薄膜的工艺,目前最好性能的 512×512 元红外焦平面列阵探测器就是用液相外延 Hg1-zCd2Te 材料研制的^[1].液相外延技术现已成为各国红外研究中的重要手段.

光致发光(PL)光谱测量可用于检测材料的杂质、缺陷及晶体质量,我们用垂直浸渍液 相外延技术生长了 Hg_{1-x}Cd_xTe 薄膜,并用光荧光测量方法分析了 HgCdTe 液相外延样品) 的发光特性.

1 实验内容

采用 Hg 回流垂直浸渍液相外延系统生长 Hg_{1-x}Cd_xTe 薄膜,这种系统可生长大面积、 组份均匀、表面形貌好的样品,且溶液的 Hg 压容易控制^[2]. 生长衬底为(111)面的 CdTe 或 · CdZnTe,面积为 18mm×20mm,采用竖直进出片、水平生长的夹具固定衬底,即样品的下降 与拉起都是在竖直方向,而生长则在水平方向. 在水平方向生长可使外延层的组份和厚度均 匀,而以垂直方式脱离生长溶液可以减少母液粘连^[3]. 生长结束后,样品在富 Hg 气氛下原 位退火 6h,使材料的导电类型变为弱 p 型. 退火后 77K 时的 p 型载流子浓度 p≈1×10¹⁶ cm⁻³,迁移率>150cm²/Vs.

进行 PL 测试前,外延薄膜样品经抛光和腐蚀处理后,然后放入可控温的 Oxford 1204 液氮杜瓦瓶中,用 514nm 的 Ar*激光激发样品正表面,产生的荧光信号经抛物面镜收集后 用 Nicolet 800 傅里叶变换光谱仪分析.

2 结果与讨论

由于 Hg_{1-x}Cd_xTe 外延样品普遍存在着纵向组份的不均匀性, 而荧光测量反映的是样 品表面的信息. 为了准确地解释实验结果, 可用拟合红外透过率方法^[4,5]求出外延禅品的表 面组份, 以便对 PL 信号进行分析.

本文1995年6月8日收到 よ





根据 Hougen 模型^[4],当一束光照射到 HgCdTe 外延层/CdTe 衬底两层结构的样品 表面时,其透过率 T_{1,3}为

94

$$T_{1,3} = \frac{(1-R_1)(1-H)T_{2,3}a_1}{1-R_1(1-H)R_{2,3}(a_1)^2}.$$
 (1)

其中 R₁、R₂、R₃分别是 3 个界面的反射率, a₁ 是外延层吸收率, 与薄膜纵向组份分布有 关^[5].

Hg1---Cd-Te 外延薄膜的纵向组份分布可 表示为^[4]

$$x(z) = \frac{1 - (x_i + sd)}{1 + 4(z/\Delta z)^2} + (x_i + sd) - sz, \quad (2)$$

式中 z 是外延层离开衬底的距离, x, ,s、Az 是 拟合参数, x, 与外延层表面组份有关, Az 与过 渡区宽度有关, s 与外延层组份的纵向变化率 有关.这3个参数可通过拟合室温红外透过率 的吸收边及本征吸收区得到^[5].式(1)和(2)对 用 MBE、LPE、MOCVD 等外延技术生长的 Hg_{1-x}Cd_xTe 外延祥品均适用.



of epilayer is x=0.413)

图 1(a)为 PL 测量使用的 p 型 Hg_{1-x}Cd_xTe 液相外延薄膜样品在 300K 和 77K 时的红 外透射曲线. 图中圆点为实验数据,实线为计算结果. 计算时根据室温透射光谱拟合求出式 (2)中 *s*,,*s*, Δz 的值,然后只改变温度,令 T=77K,代入式(1)求出 77K 时的透过率. 可见此 时的计算结果仍与实验点符合,说明公式(1)和(2)拟合纵向组份分布的模型在低温情况下 仍然成立.



图 3 (a) 4.2K 时 p 型 Hgi-_Cd.Te 液相外延轉膜样品的变光强 PL 光谱(样品的表面组份 x=0.413),(b) PL 光谱发光强度与入射微光功率的变化关系

Fig. 3 (a) The photoluminescence of p-type $Hg_{1-z}Cd_xTe$ liquid phase epitaxy film with variable laser intensity at 4.2K (the surface composition of epilayer is x=0.413). (b) dependence of PL intensity on laser intensity

图 1(b)为拟合(a)中的室温透过率得到的 外延层纵向组份分布,可见该样品的表面组份 x,=0.413,过渡区宽度 Δz~1.2μm. 由禁带宽 度公式[6]

 $E_{x}(x,T) = -0.295 + 1.87x - 0.28x^{2}$

 $+(6-14x+3x^{2}(10^{-4})T+0.35x^{4})$ (3) 可求出不同温度下样品表面层的带宽.

图 2 为图 1Hg1--Cd.Te 液相外延样品在不 同测试温度下的光荧光谱.由图可知,当温度下 降时,最高能量发光峰的峰强逐渐增大,并伴有 蓝移现象,当温度降到 4.2K 时,在最高峰的低 能侧约10meV 处又出现一个发光峰。

为了判断 4.2K 时出现的 2 个发光峰的性 质,我们在不同的激光功率下进行了 PL 测试, 并给出了 PL 信号的强度随入射激光功率的变 化关系,如图 3(a)和(b).由图可见,在不同的 激发功率下 2 个 PL 峰基本呈对称线型,这样 liquid phase epitaxial film after thinned at 77K 可以用两个高斯函数来拟合 PL 谱. 激子复合 **跃迁强度**I_#用高斯函数表示为[7]





Fig. 4 Photoluminescence of Hg1-3Cd2Te (the laser power density is 300mW/cm^{t})

$$I_{ex} = A \exp\left[-\frac{\left[\hbar w - E(T)\right]^2}{2\sigma^2(T)}\right] \exp\left(-\frac{\hbar w}{k_B T}\right),\tag{4}$$

式中A、E(T)、σ(T)分别为激子跃迁的振幅、能量位置和扩展因子.由于很难从实测 PL 谱 中准确确定各峰的能量位置,为此可以通过调节式(4)中的参数A、E(T)、σ(T)、使式(4)的 计算结果与实验光谱符合,由此得到的峰值能量E(T)较精确^[*].

通过对图 3 中 PL 信号的拟合,可知 4.2K 时出现的 A、B 两个发光峰对应的能量分别 是 432meV 和 416meV,各峰的强度随着入射激光功率的增大而增加.在对数坐标中,A、B 峰的发光强度 I_{PL} 与入射激光功率 P_L 均有较好的线性关系.如果将 I_{PL} 与 P_L 的关系用指数 形式表示,即 $I_{PL} = C \cdot P_L'(C$ 为比例系数),则 A、B 峰的指数因子 7 分别为 1.43 和 1.4,这 说明它们都与束缚激子发光有关.因为自由激子的发光强度 I_{PL} 与激光功率 P_L 基本成线性 关系,即 $\gamma \approx 1$,而束缚激子发光对应的指数因子 7 大于 1^[8,9].

根据式(3)可以算出当表面组份 x=0.413 时,其对应的带宽 $E_g=440$ meV,这样,A 峰的能量位置比禁带宽度 E_g 约小 8meV.由于 p型 $Hg_{1-z}Cd_x$ Te 的空穴有效质量大,组份无序 等将引起波函数变化,从而产生局域激子 LX.当 $x\approx0.4$ 时,局域化能级约为 10meV^[10.11]. 这样,结合光强与激光功率的关系可以认为 A 峰发光是由局域化激子 LX 引起的.B 峰的能量比 E_g 约小 24meV,该能级位置与用类氢模型算出的 $Hg_{1-z}Cd_x$ Te 的类氢受主能级相近,可见 B 峰是类氢受主 BX 发光.这一受主能级与 $Hg_{1-z}Cd_x$ Te 液相外延薄膜中 Hg 空位的存在有关^[12].

将图1样品的外延层用抛光和腐蚀方法仔细减薄至 2µm 左右,然后在 77K 下进行 PL 测量,结果如图 4 所示.可见 PL 谱的噪声较大,其 77K 时的峰值能量位置为 584meV,比未 减薄样品的峰位约高 145meV,半峰宽也增加到 37meV.通过拟合透射光谱得到此时样品的 表面组份变为 x≈0.5.因为 HgCdTe 和 CdTe 的自由能不相等,在液相外延生长过程中衬 底的 Cd 原子将向外延层中扩散,这样,随着外延层厚度的减薄,Hg_{1-x}Cd_xTe 的组份 x 将增 加,使 PL 信号的峰值向高能端移动.又由于液相外延生长的初期阶段缺陷、位错较多,成核 不均匀^[13],及抛光过程中引入的应力损伤等影响,故外延层减薄后,其 PL 谱的半峰宽和噪 声变大.

3 结论

用荧光光谱对 Hg1---Cd_Te 液相外延薄膜样品进行了分析,观察到了局域激子及束缚 激子发光.由于外延薄膜的纵向组份不均匀,当外延层减薄后,PL 信号峰位将向高能方向移动.

参考文献.

- 1 Daniel Amingual. SPIE, 1991, 40, 1512
- 2 李 标,陈新强,褚君浩,等.红外与毫米波学报,1995,14(3);216
- 3 Wan C F, Weirauch D F, Korenstein R, et al. J. Electron. Materials, 1986, 15, 151
- 4 Hougen C A. J Appl. Phys. ,1989,66:3763
- 5 Lí Biao, Chu J H. Liu K. et al J. Phys. C, 1995, 7:29
- 6 Chu J H, Xu S Q, Tang D Y. Appl. Phys. Lett. , 1983, 43: 1064

7 沈文忠.博士论文,中科院上海技术物理所,1995:120

10 Fuchs F. Koidl P. Semicond Sci. Technol. , 1991, 6:71

2 期

- 11 Tomm J W, Hermann H. J. Cryst. Growth, 1994, 138:175
- 12 Capper P, Gosney J J. Jones C L, et al. J. Cryst. Growth, 1985, 71:57
- Sher A. et al. J. Vac. Sci. Technol. A, 1990, 8:1093 13

PHOTOLUMINESCENCE OF Hg1-*Cd*Te LPE FILMS

Li Biao Chang Yong Chu Junhao Chen Xinqiang

Cao Juying Tang Wenguo Tang Dingyuan (National Laboratory for Infrared Physics, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Stiences Shanghai 200083 , China)

Abstract The infrared photoluminescense of $Hg_{1-z}Cd_zTe$ LPE films was presented. The localized exciton (LX) and bound exciton (BX) were observed from the PL measuement. After reducing the epilayer thickness to about 2µm, the movement of PL peak to higher energy side occurred, which was ascribed to the non-uniformity of longitudinal composition of $Hg_{1-x}Cd_xTe$ epilayer.

Key words photoluminescence, $Hg_{1-x}Cd_xTe$, liquid phase epitaxy.